

Zepto

Low-pressure plasma

低压等离子系统

适用于等离子清洗、活化、蚀刻及涂层



Zepto

Low-pressure plasma

低压等离子系统

技术参数

重量

约 15kg (33 lbs)(不含泵)

真空腔体

石英玻璃 (UHP) 圆形配铰链门

直径 105 mm (4.1")

长 200 mm (7.9") 或 300 mm (11.8")

硼硅玻璃 (UHP) 圆形配铰链门

直径 105 mm (4.1")

长 200 mm (7.9") 或 300 mm (11.8")

W6 (适用于6"晶圆)

直径 160 mm (6.3")

长 180 mm (7.1")

腔体容积

约 1.7 - 2.6 升

气体供应

针阀

质量流量控制器(MFCs)

发生器频率

40 kHz 功率 0 - 100 W

13,56 MHz 功率 0 - 200 W

电极

包裹于腔体外壁的电极

RIE电极配有气浴(仅适用于Zepto RIE型)

控制

手动

PCCE自动控制(基于Microsoft Windows CE系统)

PC自动控制(基于Microsoft Windows POS Ready 2009系统)

旋转开关

电源

230 V

载物架

1x载物托盘

压力监控

Pirani真空计(手动设备可选)

Technical data

Weight

Approx. 15 kg (33 lbs) (without pump)

Vacuum Chamber

Quartz glass (UHP) round with lid

Diameter 105 mm (4.1")

Length 200 mm (7.9") or 300 mm (11.8")

Borosilicate glass (UHP) round with lid

Diameter 105 mm (4.1")

Length 200 mm (7.9") or 300 mm (11.8")

W6

Diameter 160 mm (6.3")

Length 180 mm (7.1")

Chamber volume

Approx. 1.7 - 2.6 litres

Gas Connection

Needle valve

Mass Flow Controllers (MFCs)

Generator Frequency

40 kHz Power 0 - 100 W

13,56 MHz Power 0 - 300 W

Electrodes

RIE electrodes with gas shower

Control

Manual

PCCE-control (Microsoft Windows CE)

PC-control (Microsoft Windows POS Ready 2009) Rotary switch

Power supply

230 V

Partial recording

1x Product carrier

Pressure measurement

Option Pirani